## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-310556

(43) Date of publication of application: 09.11.1999

(51)Int.CI.

C07C215/08 C07C213/00 C07C231/12 C07C233/31

(21)Application number: 10-118711

(71)Applicant: YOSHITOMI PHARMACEUT IND LTD

(22)Date of filing:

28.04.1998

(72)Inventor: MISHINA TADASHI

**OBARA TOSHIYUKI** 

ADACHI KUNITOMO

## (54) NOVEL PROCESS FOR PRODUCING 2-AMINO-2-(2-(4OCTYLPHENYL) ETHYL) PROPANE-1,3-DIOL (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a novel production process for 2-amino-2-[2-(4octylphenyl) ethyl] propane-1.3-diol that is useful as an immunosuppressant agent.

SOLUTION: The 2-amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol can produced by reacting diethyl acetamidemalonate with a (2-haloethyl)benzene to form 2-acetamide-2-phenyl-ethyl malonate, after reduction, acetyulating it, further introducing an octyanoyl group to give 2-acetamide-2-acetoxymethyl-4-(4 octanovlphenyl)butyl acetate followed by hydrolysis and reduction of the product, as the intermediates in the individual steps can be crystallized and the production steps can be shortened.

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

### (19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平11-310556

(43)公開日 平成11年(1999)11月9日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別配号	ΡI	
C 0 7 C 215/08		C 0 7 C 215/08 213/00 231/12	
213/00			
231/12			
233/31		233/31	
		審査請求	未蘭求 請求項の数5 OL (全 9 頁)
(21)出願番号	<b>特願平</b> 10-118711	(71) 出願人	000006725 吉富製薬株式会社
(22)出顧日	平成10年(1998) 4月28日		大阪府大阪市中央区平野町2丁目6番9月
		(72)発明者	三品 正
	•	1 Day of the second	埼玉県入間市小谷田3丁目7番25号 吉富
			製薬株式会社東京研究所内
	The control of the control of the	(72)発明者	小原 利行
			埼玉県入間市小谷田3丁目7番25号 吉富
		•	製薬株式会社東京研究所内
·	eri .	(72)発明者	安達 邦知
			福岡県築上郡吉宮町大字小祝955番地 吉
	٠.		富製業株式会社九州研究所内
		(74)代理人	弁理士 高宮城 勝

# (54) 【発明の名称】 2-アミノ-2-[2-(4-オクチルフェニル) エチル プロパン-1, 3-ジオールの新規 な製造法

### (57)【要約】

【課題】 免疫抑制剤として有用な2-アミノー2-[2-(4-オクチルフェニル) エチル] プロパンー1,3-ジオールの工業的に有利な製造法を提供する。【解決手段】 ジエチル アセタミドマロネートを(2-ハロエチル) ベンゼンと反応させてジエチル 2-アセタミドー2-フェニルエチルマロネートとし、還元後、アセチル化し、さらにオクタノイル基を導入して2-アセタミドー2-アセトキシメチルー4-(4-オクタノイルフェニル) ブチル アセテートとし、加水分解および還元することにより、各工程の中間体を結晶化することができ、しかも短い工程で2-アミノー2-[2-(4-オクチルフェニル) エチル] プロパン-1,3-ジオールを製造することができる。

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】ジエチル アセタミドマロネートを(2-ハロエチル)ベンゼンと塩基性化合物の存在下で反応さ せてジエチル 2-アセタミド-2-フェニルエチルマ ロネートとし、これを還元した後、さらにアセチル化し て2ーアセタミドー2ーアセトキシメチルー4ーフェニ ルプチル アセテートとし、次にこの化合物のフェニル 基のパラ位にオクタノイル基を導入することを特徴とす る2-アセタミド-2-アセトキシメチル-4-(4-オクタノイルフェニル)ブチル アセテートの製造法。 【請求項2】ジエチル アセタミドマロネートを(2-ハロエチル)ベンゼンと塩基性化合物の存在下で反応さ せてジエチル 2-アセタミド-2-フェニルエチルマ ロネートとし、これを還元した後、さらにアセチル化し て2-アセタミド-2-アセトキシメチル-4-フェニ ルブチル アセテートとし、次にこの化合物のフェニル 基のパラ位にオクタノイル基を導入して2-アセタミド -2-アセトキシメチルー4-(4-オクタノイルフェ ニル)ブチル アセテートとし、これを加水分解して2 ーアミノー2ー [2-(4-オクタノイルフェニル) エ チル] プロパン-1, 3-ジオールとした後、これを還 元することを特徴とする2-アミノ-2-[2-(4-オクチルフェニル) エチル] プロパン-1, 3-ジオー ルまたはその製薬上許容しうる塩の製造法。

【請求項3】 ジエチル アセタミドマロネートを (2-ハロエチル)ベンゼンと塩基性化合物の存在下で反応さ せてジエチル 2-アセタミド-2-フェニルエチルマ ロネートとし、これを還元した後、さらにアセチル化し て2-アセタミド-2-アセトキシメチル-4-フェニ ルブチル アセテートとし、次にこの化合物のフェニル -2-アセトキシメチルー4-(4-オクタノイルフェ ニル) ブチル アセテートとし、これを還元して2-ア セタミドー2ーアセトキシメチルー4ー(4ーオクチル フェニル) ブチル アセテートとした後、これを加水分 解することを特徴とする2-アミノ-2-[2-(4-オクチルフェニル) エチル] プロパン-1, 3-ジオー ルまたはその製薬上許容しうる塩の製造法。

【請求項4】2-アセタミド-2-アセトキシメチル-4-(4-オクタノイルフェニル) プチル アセテート を加水分解して2-アミノー2- [2-(4-オクタノ イルフェニル) エチル] プロパンー1, 3ージオールと した後、これを還元することを特徴とする2ーアミノー 2-[2-(4-オクチルフェニル)エチル]プロパン -1.3-ジオールまたはその製薬上許容しうる塩の製 造法。

【請求項5】2-アセタミド-2-アセトキシメチル-4-(4-オクタノイルフェニル) ブチル アセテート を還元し、2-アセタミド-2-アセトキシメチル-4 - (4-オクチルフェニル) ブチル アセテートとした 後、これを加水分解することを特徴とする2-アミノー 2- [2-(4-オクチルフェニル) エチル] プロパン -1.3-ジオールまたはその製薬上許容しうる塩の製 造法。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は免疫抑制剤として有 用な2-アミノ-2-[2-(4-オクチルフェニル) エチル] プロパン-1.3-ジオールまたはその製薬上 許容しうる塩およびその製造中間体の製造法に関する。 [0002]

【従来の技術】2-アミノ-2- [2-(4-オクチル フェニル) エチル] プロパンー1, 3ージオールまたは その医薬上許容しうる酸付加塩は、例えば、国際公開W ○94/08943号公報により、臓器または骨髄移植 における拒絶反応の抑制薬として、また乾癬、ベーチェ ット病等の様々な自己免疫疾患およびリウマチ疾患の治 療薬として有用であることが記載されている。当該公報 基のパラ位にオクタノイル基を導入して2-アセタミド : .....には2-アミノ-2- [2-(4-オクチルフェニル) エチル] プロパン-1, 3-ジオールまたはその塩の製 造法として、フェネチル アセテートを原料化合物とす る全8工程にて製造する下記二つの方法が記載されてい る。

> [0003] 【化1】

【0004】(式中、Acはアセチルを、Meはメチルを、Etはエチルを示す。)

上記製造法における中間体のうち、2 - (4 - オクタノ イルフェニル) エチルアセテート、2 - (4-オクチル フェニル) エチル アセテート、2-(4-オクチルフ ェニル) エタノール、2-(4-オクチルフェニル) エ チル メタンスルフォネートおよびヨー化 2-(4-オクチルフェニル) エチルは油状物質であることが記載 されている。さらに前記公報には2-アミノー2-[2 - (4-オクタノイルフェニル) エチル] プロパンー 1, 3-ジオールが例示化合物として記載されている。 【0005】一方、ジャーナル オブ アメリカン ケ ミカル ソサイエティ (J. Am. Chem. So c.) 76巻、1909頁、1954年およびジャーナ ル オブケミカル ソサイエティ (J. Chem. So c.) 890頁、1955年には、フェネチル ブロミ ドとジエチル アセタミドマロネートを塩基の存在下に 縮合し、ジエチル 2-フェニルエチルアセタミドマロ ネートを製造する方法が記載されている。

【0006】また、国際公開W096/06068号公報には、フリーデルクラフツ反応を用いた下式により表される製造法が記載されている。

[0007]
[(E2]

W

NR<sub>1</sub>R<sub>2</sub>

(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>OR<sub>3</sub>

NR<sub>1</sub>R<sub>2</sub>

(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>OR<sub>3</sub>

NR<sub>1</sub>R<sub>2</sub>

W

CH<sub>2</sub>M<sub>0</sub>OR<sub>3</sub>

CH<sub>2</sub>XA

[0008]

【発明が解決しようとする課題】国際公開WO94/08943号公報に記載された2-アミノー2-[2-(4-オクチルフェニル)エチル]プロパン-1,3-ジオールまたはその医薬上許容しうる酸付加塩の製造法

5

においては、製造工程数が長いことに加え、室温では液体である中間体が多いため再結晶による精製が困難であり、工業的製法としては好ましいものではない。したがって、2-アミノ-2-[2-(4-オクチルフェニル)エチル]プロパン-1、3-ジオールまたはその塩をより少ない工程で製造することができ、さらに、再結晶による精製が可能な室温で固体である中間体を経由する工業的に有利な製造法を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】すなわち、本発明は、ジ 10 エチル アセタミドマロネートを(2-ハロエチル)べ ンゼンと塩基性化合物の存在下で反応させてジエチル 2-アセタミド-2-フェニルエチルマロネートとする 工程A、ジエチル 2-アセタミド-2-フェニルエチ ルマロネートを還元し、さらにアセチル化して2-アセ タミドー2ーアセトキシメチルー4ーフェニルブチル アセテートとする工程B、2-アセタミド-2-アセト キシメチルー4ーフェニルブチル アセテートのフェニ ル基のパラ位にオクタノイル基を導入して2-アセタミ ドー2ーアセトキシメチルー4ー(4ーオクタノイルフ ェニル) ブチル アセテートとする工程 C、2ーアセタ ミドー2-アセトキシメチルー4-(4-オクタノイル フェニル) ブチル アセテートを還元して2-アセタミ ドー2ーアセトキシメチルー4ー(4ーオクチルフェニ ル) ブチル アセテートとする工程D、2-アセタミド -2-アセトキシメチル-4-(4-オクチルフェニ ル) ブチルアセテートを加水分解して2-アミノー2-[2-(4-オクチルフェニル) エチル] プロパンー 1. 3 - ジオールまたはその製薬上許容しうる塩とする 工程 E、2-アセタミド-2-アセトキシメチル-4-(4-オクタノイルフェニル) ブチル アセテートを加 水分解して2-アミノ-2-[2-(4-オクタノイル フェニル) エチル] プロパンー1.3-ジオールとする

工程F、および2-アミノー2- [2-(4-x)/9/4) イルフェニル)エチル] プロパン-1,  $3-\tilde{y}$ オールを 還元して2-アミノー2- [2-(4-x)/2) 変上許容しうる塩とする工程[2-(4-x)/2] でいたして2-アミノー2- [2-(4-x)/2] アロパン-1,  $3-\tilde{y}$ 3-ルまたはその製薬上許容しうる塩の製造法に関する。

【0010】さらに、2-アミノ-2-[2-(4-オ クチルフェニル) エチル] プロパン-1, 3-ジオール またはその製薬上許容しうる塩の製造法としては、上記 製造工程に加え、2ーアセタミドー2ーアセトキシメチ ルー4-(4-オクタノイルフェニル) ブチル アセテ ートを加水分解して2ーアセタミド-2-[2-(4-オクタノイルフェニル) エチル] プロパン-1, 3-ジ オールとする工程H、2-アセタミド-2-[2-(4 ーオクタノイルフェニル)エチル]プロパンー1,3-ジオールを還元して2-アセタミド-2-[2-(4-オクチルフェニル) エチル] プロパン-1、3-ジオー ルとする工程 I、2-アセタミド-2-[2-(4-オ クチルフェニル) エチル] プロパン-1, 3-ジオール を加水分解して2-アミノ-2-[2-(4-オクチル) フェニル) エチル] プロパンー1, 3-ジオールまたは その製薬上許容しうる塩とする工程」、および2-アセ タミドー2ーアセトキシメチルー4ー(4ーオクチルフ ェニル)ブチル アセテートを加水分解して2-アセタ ミドー2-[2-(4-オクチルフェニル)エチル]プ ロパン-1, 3-ジオールとする工程 K もあげることが でき、これら各工程も本発明に包含される。なお、本発 明の製造法は下式の通りである。

[0011] [化3]

40

### [0012]

【発明の実施の形態】2-アミノー2- [2-(4-オクチルフェニル)エチル]プロパン-1,3-ジオールの製薬上許容しうる塩としては、塩酸塩、臭化水素酸塩、硫酸塩などの無機酸との塩、または酢酸塩、フマル酸塩、マレイン酸塩、安息香酸塩、クエン酸塩、リンゴ酸塩、メタンスルホン酸塩、ベンゼンスルホン酸塩等の有機酸との塩があげられ、好ましくは塩酸塩である。

【0013】工程Aはジャーナル オブ アメリカンケミカル ソサイエティ(J. Am. Chem. Soc.)76巻、1909頁、1954年およびジャーナル オブ ケミカル ソサイエティ(J. Chem. Soc.)890頁、1955年に準じて製造することができる。反応に用いられる塩基性化合物としてはナトリウムまたはナトリウムエトキシドの他に水素化ナトリウム、カリウム第3級ブトキシ、リチウム ジイソプロピルアミド等を用いることもできる。反応溶媒としては、エタノールの他に第3級ブチルアルコール、N, Nージメチルホルムアミド、1, 3ージメチルー2ーイミダゾリジノン、ジメチルスルホキシド、テトラヒドロフラン、ジメトキシエタン、ジオキサン、トルエン等または

30 これらの混合溶媒を用いることができる。

【0014】工程Bにおけるエステルの還元反応は還元剤として、水素化リチウムアルミニウム、水素化ホウ素ナトリウム、水素化ホウ素リチウム、水素化ナトリムビス(2ーメトキシエトキシ)アルミニウム、ボラン、水素化ジイソプロピルアルミニウム等を用いることができる。反応溶媒としては、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、第3級ブチルアルコール、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジメトキシエタン、2ーメトキシエチルエーテル、ジオキサン、トルエン等またはこれらの混合溶媒を用いることができる。本反応の反応温度は、用いる試薬により異なるが、一20℃から用いる溶媒の沸点である。反応時間は反応条件により異なるが、通常1~24時間である。

【0015】工程Bにおけるアセチル化試薬としては、無水酢酸または塩化アセチル、臭化アセチル等のアセチルハライドを用いることができる。反応溶媒としては、反応において不活性な溶媒であれば何れでもよいが、中でもピリジン、ジクロロメタン、クロロホルム、テトラヒドロフラン、ジオキサン、トルエン、アセトニトリル、N、Nージメチルホルムアミド、酢酸エチル等また

はこれらの混合溶媒が好ましい。さらに触媒として、ピリジン、4ージメチルアミノピリジン、4ーピロリジノピリジン等を用いることもでき、これら触媒を用いて反応を行う方が好ましい。本反応の反応温度は、用いる試薬により異なるが、-20℃から用いる溶媒の沸点である。反応時間は反応条件により異なるが、通常1~24時間である。

【0016】工程Cのフリーデルクラフツ反応において、オクタノイル基を導入する試薬としては、塩化オクタノイル、臭化オクタノイル等のオクタノイルハライドまたは無水オクタン酸等があげられ、オクタノイルハライドが好ましい。反応に用いる酸触媒としては、無水三塩化アルミニウム、無水三臭化アルミニウム、無水塩化亜鉛、無水塩化第二鉄、無水四塩化チタン、三フッ化ホウ素等のルイス酸があげられる。用いる溶媒としては、反応において不活性な溶媒であれば何れでもよいが、なかでも1、2ージクロロエタン、ジクロロメタン、クロロホルム等が好ましい。本反応の反応温度は、用いる酸触媒やオクタノイル基を導入する試薬により異なるが、一20℃から用いる溶媒の沸点である。反応時間は反応条件により異なるが、通常1~24時間である。

【0017】工程Dにおけるケトンの還元反応として は、有機合成化学の分野における公知の還元方法、たと えば、酸性条件下に金属を用いるクレメンゼン還元、ア ミン溶液中におけるバーチ還元、ヒドロシランによる還 元または接触還元などにより行われるが、なかでも接触 還元の方法が好ましい。接触還元反応は水素および触媒 としてパラジウム系触媒(パラジウム、パラジウム炭素 など) または白金などを用いるか、またはラネーニッケ ルを用いることにより行われるが、なかでも水素存在下 でパラジウム系触媒を用いることが好ましい。用いる溶 媒としては、反応において不活性な溶媒であれば何れで もよいが、メタノール、エタノール、イソプロピルアル コール、酢酸エチル、酢酸、テトラヒドロフラン、ジオ キサン、トルエン等またはこれらの混合溶媒が好まし い。また、塩酸、酢酸等の酸を添加することにより反応 を加速することができる。本反応の反応温度は、用いる 触媒により異なるが、-20℃から用いる溶媒の沸点で ある。反応時間は反応条件により異なるが、通常1~2 4時間である。

【0018】工程Eにおけるアセチル基の加水分解反応は、塩基または酸の存在下で行うことができる。塩基の存在下で反応を行う場合、用いる塩基としては、水酸化ナトリウム、水酸化リチウム、水酸化カリウム、水酸化バリウム等が好ましく、用いる溶媒としては、反応において不活性な溶媒であれば何れでもよいが、なかでも水、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、テトラヒドロフラン、ジオキサン等またはこれらの混合溶媒が好ましい。また、酸の存在下に行う場合、用いる酸としては、塩酸、硫酸、酢酸などがあげられる

が、なかでも塩酸が好ましく、用いる溶媒としては、反 応において不活性な溶媒であれば何れでもよいが、なか でも水、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコ ール等またはこれらの混合溶媒が好ましい。反応温度 は、50℃から溶媒の沸点までが好ましい。反応時間は 反応条件により異なるが、通常1~24時間である。 【0019】工程Fにおける試薬、溶媒および反応条件 は工程Eと同様である。工程Gにおけるケトンの還元反 応としては、有機合成化学の分野における公知の還元方 法、たとえば、酸性条件下に金属を用いるクレメンゼン 還元、塩基性条件下でヒドラジンを用いるボルフキシュ ナー還元、アミン溶液中におけるバーチ還元、ヒドロシ ランによる還元または接触還元などにより行われるが、 なかでも接触還元の方法が好ましい。接触還元反応は水 素および触媒としてパラジウム系触媒(パラジウム、パ ラジウム炭素など)または白金などを用いるか、または ラネーニッケルを用いることにより行われるが、なかで も水素存在下でパラジウム系触媒を用いることが好まし い。用いる溶媒としては、反応において不活性な溶媒で あれば何れでもよいが、水、メタノール、エタノール、 イソプロピルアルコール、酢酸、テトラヒドロフラン、

ジオキサン等またはこれらの混合溶媒が好ましい。ま

た、塩酸、酢酸等の酸を添加することにより反応を加速

することができ、塩酸を添加した場合、目的物を塩酸塩 として得ることができる。本反応の反応温度は、用いる

触媒により異なるが、-20℃から用いる溶媒の沸点である。反応時間は反応条件により異なるが、通常1~2

4時間である。

【0020】工程Hにおけるエステル結合の加水分解反応は、塩基の存在下で行うことができる。用いる塩基としては、水酸化ナトリウム、水酸化リチウム、水酸化カリウム、水酸化バリウム、アンモニア等が好ましく、用いる溶媒としては、反応において不活性な溶媒であれば何れでもよいが、なかでも水、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、テトラヒドロフラン、ジオキサン、アセトン、アセトニトリル等またはこれらの混合溶媒が好ましい。反応温度は室温から50℃までが好ましい。反応時間は反応条件により異なるが、通常1~24時間である。

【0021】工程Iにおけるケトンの還元反応としては、有機合成化学の分野で通常用いられる還元反応、たとえば、酸性条件下に金属を用いるクレメンゼン還元、塩基性条件下でヒドラジンを用いるボルフキシュナー還元、アミン溶液中におけるバーチ還元、ヒドロシランによる還元または接触還元などにより行われるが、なかでも接触還元、クレメンゼン還元またはヒドロシランによる還元の方法が好ましい。接触還元反応は水素および触媒としてパラジウム系触媒(パラジウム、パラジウム炭素など)または白金を用いるか、またはラネーニッケルを用いることにより行われるが、なかでも水素存在下で

パラジウム系触媒を用いることが好ましい。この反応に 用いる溶媒としては、反応において不活性な溶媒であれ ば何れでもよいが、水、メタノール、エタノール、イソ プロピルアルコール、酢酸、テトラヒドロフラン、ジオ キサン等またはこれらの混合溶媒が好ましい。また、塩 酸、酢酸等の酸を添加することにより反応を加速するこ とができる。本反応の反応温度は、用いる触媒により異 なるが、-20℃から用いる溶媒の沸点である。反応時 間は反応条件により異なるが、通常1~24時間であ る。クレメンゼン還元の試薬としては、金属として亜鉛 または亜鉛アマルガムを用い、酸として塩酸または酢酸 を用いることが好ましい。本反応の溶媒としては、水、 メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、酢 酸、テトラヒドロフラン、ジオキサン等またはこれらの 混合溶媒を用いることができる。本反応の反応温度は、 用いる試薬により異なるが、-20℃から用いる溶媒の 沸点である。反応時間は反応条件により異なるが、通常 1~24時間である。ヒドロシランによる還元反応は、 試薬としてトリエチルシランが好ましい。本反応は酸性 条件下で行われ、鉱酸、トリフルオロ酢酸または三フッ 化ホウ素等のルイス酸などが用いられるが、なかでもト リフルオロ酢酸が好ましい。本反応の反応温度は、用い る試薬により異なるが、−20℃から用いる溶媒の沸点 である。反応時間は反応条件により異なるが、通常1~ 2 4 時間である。

【0022】工程」におけるアミド結合の加水分解反応の試薬、溶媒、反応温度は工程 E におけるものと同じである。工程 K におけるエステル結合の加水分解反応の試薬、溶媒、反応温度は工程 H におけるものと同じである。本発明の製造法により製造される 2 ーアミノー 2 ー [2ー(4ーオクチルフェニル)エチル]プロパンー1、3ージオールは、必要に応じて適当な溶媒(メタノール、エタノール、ジエチルエーテル、ジオキサン等)中、酸(塩酸、臭化水素酸、硫酸などの無機酸または酢酸、フマル酸、マレイン酸、安息香酸、クエン酸、リンゴ酸、メタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸等の有機酸等)と処理することにより酸付加塩とすることができる。

【0023】上記工程の各反応で得られた目的物は、遠心分離、濃縮、分液、洗浄、乾燥、再結晶、蒸留などの通常の手段を適宜組み合わせることにより単離精製することができる。本発明の製造法により製造される2-アミノー2-[2-(4-オクチルフェニル)エチル]プロパン-1,3-ジオールまたはその製薬上許容しうる塩は、優れた免疫抑制作用を示し、臓器または骨髄移植後の拒絶反応の抑制やその維持免疫療法、あるいは慢性関節リウマチなどのリウマチ疾患、ベーチェット病またはぶどう膜炎等の眼疾患、乾癬、アトピー性皮膚炎、接触皮膚炎およびアレルギー性皮膚炎等の皮膚炎などを含む各種自己免疫疾患あるいはアレルギー疾患の予防また50

は治療に用いることができる。

[0024]

【実施例】以下、実施例をあげて本発明を詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

実施例

工程A:ジエチル 2-アセタミド-2-(2-フェニルエチル) マロネート

N, N-ジメチルホルムアミド(50ml)中に水素化 ナトリウム (12.0g) を分散し、そこへN、Nージ メチルホルムアミド(200ml)に溶解したジエチル アセタミドマロネート(66.2g)を5℃で2時間 かけて攪拌下に滴下した。室温で2時間攪拌後, その混 合物に、N、N-ジメチルホルムアミド(40ml)に 溶解したフェネチル ブロミド (44.4g) を室温で 30分かけて滴下した。12時間攪拌後、反応液を氷水 に注ぎ、酢酸エチルで抽出した。有機層を食塩水で洗浄 後無水硫酸ナトリウムで乾燥し減圧下に濃縮した。残渣 をヘキサンー酢酸エチルを溶出溶媒に用いたシリカゲル カラムクロマトグラフィーで精製し無色結晶としてジエ チル 2-アセタミド-2-(2-フェニルエチル)マ ロネート (36g) を得た。融点115-117℃ IR (KBr): 3236, 1745, 1635 cm<sup>-1</sup> <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): 1. 22 (6H, t, J = 7.3 Hz), 1.96 (3H, s), 2.44-2. 48 (2H, m), 2. 65-2. 69 (2H, m)m), 4. 17 (2H, q, J = 7. 3Hz), 4. 1 9 (2H, q, J=7. 3Hz), 6. 74 (1H, b r. s), 7. 11-7. 26 (5H, m)

MSm/e:321

工程B:2-アセタミド-2-アセトキシメチルー4ーフェニルプチル アセテートテトラヒドロフラン(200ml)中に水素化リチウムアルミニウム(3.78g)を懸濁し、テトラヒドロフラン(100ml)に溶解したジエチル 2-アセタミド-2-(2-フェニルエチル)マロネート(16.0g)を5℃で1時間かけて攪拌下に滴下した。室温で3時間攪拌後、その混合物に飽和硫酸ナトリウム溶液を加え、その懸濁液を濾過した。濾液を減圧下に濃縮し、ピ

リジン(216ml)と無水酢酸(48ml)を加えた。室温で12時間攪拌後,混合物を減圧下に濃縮し、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水,飽和炭酸水素ナトリウム水溶液,飽和食塩水,希塩酸,飽和食塩水の順で洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧下に濃縮して2-アセタミド-2-アセトキシメチル-4-フェニルブチル アセテート(9.34g)を得た。融点116-117℃

IR (KBr) : 2925, 1485, 1070, 10  $10\,\mathrm{cm^{-1}}$ 

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): 1. 94 (3H, s), 2. 07 (6H, s), 2. 20 (2H, m), 2. 5 9 (2H, m), 4. 33 (4H, s), 5. 64 (1 H, br. s), 7. 15-7. 28 (5H, m) MSm/e:321

工程 C: 2-アセタミド-2-アセトキシメチル-4-(4-オクタノイルフェニル) ブチル アセテート 1, 2-ジクロロエタン(360ml)中の塩化アルミ ニウム (31.0g) 懸濁液に, 塩化オクタノイル (1 9.8 m l) を室温下に加えた。2時間攪拌後, その混 合物に1.2-ジクロロエタン(100ml)に溶解し た2-アセタミド-2-アセトキシメチル-4-フェニ ルブチル アセテート (9.34g) を室温下に30分 かけて加えた。室温で12時間攪拌後、その混合物を5 0℃で1時間攪拌し、氷水中に注いだ。混合物をエチル エーテルで抽出し, 有機層を飽和食塩水で洗浄し, 無水 硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧下に濃縮した。生成物を ヘキサン一酢酸エチルを溶出溶媒に用いたシリカゲルカ ラムクロマトグラフィーで精製し淡黄色結晶として2-アセタミド-2-アセトキシメチル-4-(4-オクタ ノイルフェニル) ブチル アセテート(8.30g) を 得た。融点70-74℃

IR (KBr): 3314, 1651, 1610, 12 59 c m<sup>-1</sup>

H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): 0. 86 (3H, t, J =6. 5Hz), 1. 26-1. 32 (8H, m), 1. 69 (2H, t, J=6. 8Hz), 1. 96 (3H, s), 2. 08 (6H, s), 2. 19-2. 23 (2H, m), 2. 62-2. 66 (2H, m), 2. 92 (2H, t, J=6. 8Hz), 4. 32 (4H, s), 5. 69 (1H, br. s), 7. 26 (2H, d, J=7. 8Hz)

MSm/e:447

工程D:2-アセタミド-2-アセトキシメチルー4ー(4-オクチルフェニル)プチル アセテート2-アセタミド-2-アセトキシメチルー4ー(4-オクタノイルフェニル)プチル アセテート(150mg)をエタノール(10ml)に溶解し、酢酸(10ml)と10%パラジウムー炭素(40mg)を加え、その混合物を常圧接触還元装置を用いて攪拌下に水素添加させた。反応溶液を濾過し、濾液を減圧下に濃縮後、酢 60元子ルに溶解した。溶液を重曹水、飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧下に濃縮した。残渣をイソプロピルエーテルから再結晶して、無色結晶として2-アセタミド-2-アセトキシメチルー4ー(4-オクチルフェニル)プチル アセテート(106mg)を得た。融点104-106℃

IR (KBr): 3311, 2922, 1738, 16 51, 1556, 1259, 1230, 1057 cm<sup>-1</sup>  $^{1}$ H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): 0. 87 (3H, t, J = 6. 6Hz), 1. 2-1. 35 (10H, m), 1. 5-1. 7 (2H, m), 1. 94 (3H, s), 2. 08 (6H, s), 2. 1-2. 25 (2H, m), 2. 5-2. 65 (4H, m), 4. 34 (4 H, s), 5. 64 (1H, br. s), 7. 08 (4 H, s) 工程E: 2-アミノ-2-[2-(4-オクチルフェニ

ル) エチル] プロパン-1, 3-ジオール

水酸化リチウム(7.2g)の水溶液(100ml)に、2ーアセタミドー2ーアセトキシメチルー4ー(4ーオクチルフェニル)ブチル アセテート(8.25g)のメタノール溶液(100ml)を加え、混合物を2時間還流下に加熱した。混合物を減圧下に濃縮し、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下に濃縮した。生成物を酢酸エチルから再結晶することにより、無色結晶として2ーアミノー2ー[2ー(4ーオクチルフェニル)エチル]プロパンー1、3ージオールを得た。

融点 240 °C(分解)、103-105 °C(透明化)  $^1$ H-NMR(DMSO-d6):0.86(3H, t, J=6Hz),1.1-1.85(14H, m),2.38-2.79(この化学シフトはDMSOのそれと重なっている),3.5-3.6(4H, m),5.36(2H, t, J=5Hz),7.06(4H, s),7.84(3H, br.s)

工程F: 2-Pミノー2-[2-(4-x)クタノイルフェニル)エチル]プロパンー1、 $3-\vec{y}$ オール 水酸化リチウム(7g)の水(150ml)溶液に、メタノール(200ml)とテトラヒドロフラン(100ml)の混合溶媒に溶解した2-Pセタミドー2-Pセトキシメチルー4-(4-x)クタノイルフェニル)ブチル アセテート(8.30g)を加え、混合物を3時間 還流下に加熱した。混合物を減圧下に濃縮し、酢酸エチルで抽出した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧下に濃縮した。生成物をヘキサンー酢酸エチル混合溶媒から再結晶することにより、無色結晶として2-Pミノー2-[2-(4-x)クタノイルフェニル)エチル]プロパンー1、 $3-\vec{y}$ オール(2.0g)を得た。融点116-117℃

IR (KBr): 3350, 2926, 1678, 16 04,  $1508cm^{-1}H-NMR$  (CDCl<sub>3</sub>): 0.86 (3H, t, J=6.9Hz), 1.26-1.32 (8H, m), 1.68-1.72 (8H, m), 2.69 (2H, t, J=8.3Hz), 2.9 1 (2H, t, J=7.3Hz), 3.50 (2H, d, J=10.7Hz), 7.26 (2H, d, J=8.3Hz), 7.86 (2H, d, J=8.3Hz) MSm/e: 321

工程G:2-アミノ-2-[2-(4-オクチルフェニ 50 ル)エチル]プロパン-1,3-ジオール 塩酸塩

16

2-Pミノー2-[2-(4-オクタノイルフェニル) エチル] プロパンー1,  $3-\tilde{y}$ オール(100mg)を エタノールに溶解し, 1規定塩酸(0.4m1)と10%パラジウムー炭素(30mg)を加え, その混合物を 常圧接触還元装置を用いて攪拌下に水素添加させた。反 応液を濾過し、濾液を減圧下に濃縮した。残渣をエタノールーエチルエーテルから再結晶して, 無色結晶として 2-Pミノー $2-[2-(4-オクチルフェニル)エチル] プロパンー1, <math>3-\tilde{y}$ オール塩酸塩(82mg)を 得た。融点240%(分解), 110-112%(透明化)

IR (KBr): 3371, 3267, 3035, 29 22, 2850, 1601, 1518, 1070, 10 45cm<sup>-1</sup>

 $^{1}H-NMR$  (DMSO-d<sub>6</sub>): 0.85 (3H. t, J = 6.6 Hz), 1. 2-1. 3 (10 H, m), 1. 45-1. 6 (2H, m), 1. 7-1. 8 (2H, m), 2. 45-2. 6 (この化学シフトはD) MSOのそれと重なっている), 3.5-3.6(4) H, m), 5. 36 (2H, t, J = 5 Hz), 7. 1 0 (4H, s), 7.85 (3H, br. s) 工程H:2-アセタミド-2-[2-(4-オクタノイ ルフェニル) エチル] プロパン-1, 3-ジオール メタノールとテトラヒドロフランの混合溶媒に溶解した 2-アセタミド-2-アセトキシメチル-4-(4-オ クタノイルフェニル) ブチル アセテートに、水酸化ナ トリウムの水溶液を加え、混合物を室温で攪拌する。混 合物を中和後減圧下に濃縮し、酢酸エチルで抽出する。 有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧下に濃縮す る。生成物をヘキサン-酢酸エチルから再結晶し,無色 結晶として2-アセタミド-2-[2-(4-オクタノ イルフェニル) エチル] プロパン-1, 3-ジオールを 得る。

工程 I:2-アセタミド-2-[2-(4-オクチルフェニル) エチル] プロパン-1, 3-ジオール2-アセタミド-2-[2-(4-オクタノイルフェニル) エチル] プロパン-1, 3-ジオールをエタノールに溶解し、酢酸と10%パラジウム-炭素を加え、その混合物を常圧接触還元装置を用いて攪拌下に水素と反応させる。反応液を濾過し、濾液を減圧下に濃縮する。残40 渣を酢酸エチルより再結晶して、無色結晶として2-ア

セタミドー2ー [2-(4-オクチルフェニル) エチ ル] プロパン-1, 3-ジオールを得る。融点66-6 8 °C 工程 J: 2-アミノー2-[2-(4-オクチルフェニ ル) エチル] プロパン-1, 3-ジオール 水酸化ナトリウムの水溶液に、2-アセタミド-2-[2-(4-オクチルフェニル)エチル]プロパン-1. 3 - ジオールのメタノール溶液を加え、その混合物 を2時間還流下に加熱する。混合物を減圧下に濃縮し、 酢酸エチルで抽出する。有機層を飽和食塩水で洗浄し、 無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下に濃縮する。生 成物をエタノールー水から再結晶することにより、無色 結晶として2-アミノ-2-[2-(4-オクチルフェ ニル) エチル] プロパン-1, 3-ジオールを得る。融 点240℃(分解),103-105℃(透明化)  ${}^{1}H-NMR$  (DMSO-d<sub>6</sub>): 0.86 (3H, t, J = 6 H z), 1. 1-1. 85 (14H, m), 2. 38-2. 79 (この化学シフトはDMSOのそれ) と重なっている), 3.5-3.6(4H, m), 5. 36(2H, t, J=5Hz), 7. 06 (4H, s), 7. 84 (3H, br. s) 工程 K: 2 - アセタミド-2- [2-(4-オクチルフ ェニル) エチル] プロパン-1, 3-ジオール メタノールに溶解した2ーアセタミド-2ーアセトキシ メチルー4ー(4ーオクチルフェニル)ブチル アセテ ートに水酸化ナトリウムの水溶液を加え、混合物を室温 で攪拌する。混合物を減圧下に濃縮し、酢酸エチルで抽 出する。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧下 に濃縮する。生成物を酢酸エチルから再結晶することに より、無色結晶として2ーアセタミド-2- [2-(4) ーオクチルフェニル)エチル]プロパンー1,3ージオ

#### [0025]

ールを得る。融点66-68℃

【発明の効果】本発明の製造法は、従来の製造法と比較して、免疫抑制剤として有用な2ーアミノー2ー [2ー(4ーオクチルフェニル)エチル]プロパンー1,3ージオールまたはその製薬上許容しうる塩を短い工程で製造することが可能であり、さらに、各製造工程で得られる中間体をすべて結晶として単離することができるので、工業的製造法として非常に有用である。